

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 19 年 10 月 11 日 (2007.10.11)

【公表番号】特表 2003-531756 (P2003-531756A)

【公表日】平成 15 年 10 月 28 日 (2003.10.28)

【出願番号】特願 2001-580085 (P2001-580085)

【国際特許分類】

B 4 1 M 5/395 (2006.01)

G 0 2 B 5/20 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

B 4 1 M 5/382 (2006.01)

B 4 1 M 5/42 (2006.01)

B 4 1 M 5/392 (2006.01)

B 4 1 M 5/385 (2006.01)

B 4 1 M 5/39 (2006.01)

B 4 1 M 5/50 (2006.01)

B 4 1 M 5/52 (2006.01)

【F I】

B 4 1 M 5/26 L

G 0 2 B 5/20 1 0 1

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

B 4 1 M 5/26 F

B 4 1 M 5/26 J

B 4 1 M 5/26 K

B 4 1 M 5/26 H

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 8 月 22 日 (2007.8.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】熱転写ドナー要素及びその製法とパターン形成方法

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基材と、

架橋した材料を含む転写層と、

熱転写ドナー要素内に配置され、前記ドナー要素を画像形成放射線に曝露した場合に熱を発生する光 - 熱変換材料と、

を含む熱転写ドナー要素であって、

前記ドナー要素を画像形成放射線に選択的に曝露した場合に、前記ドナー要素から前記転写層を、近接して配置されたレセプターに画像状に転写することができる熱転写ドナー

要素。

【請求項2】 レセプター近傍に、基材と、架橋した材料を含む転写層と、光 - 熱変換材料とを含む熱転写ドナー要素を配置する工程と、

前記変換材料によって吸収され熱に変換することが可能な画像形成放射線に前記ドナー要素を選択的に曝露することによって、前記レセプターに前記転写層を画像状に転写する工程と、

を含む、パターン形成方法。

【請求項3】 ドナー基材を提供する工程と、

前記基材と隣接させて架橋性材料をコーティングする工程と、

前記架橋性材料を架橋させて架橋した転写層を形成する工程と、

前記ドナー要素中に、画像形成放射線に曝露することによって熱を発生することができる光 - 熱変換材料を配置する工程と、

を含み、

前記ドナー要素が画像形成放射線を選択的に曝露した場合に、前記ドナー要素から前記転写層を、近接して配置されたレセプターに画像状に転写することができる、熱転写ドナー要素の製造方法。